⑩ 公 開 特 許 公 報 (A)

昭62-66141

@Int_Cl_4

識別記号

庁内整理番号

43公開 昭和62年(1987) 3月25日

G 01 N 21/03 21/64 33/543 7458-2G 7458-2G D-7906-2G

2G 審査請求 未請求 発明の数 1 (全4頁)

②特 願 昭60-205391

②出 願 昭60(1985)9月19日

⁷⁰ 発 明 者 渡 辺 芳 明

東京都千代田区内幸町1丁目2番2号 住友ベークライト

株式会社内

79発明者 加藤 武司

東京都千代田区内幸町1丁目2番2号 住友ベークライト

株式会社内

⑪出 願 人 住友ベークライト株式

東京都千代田区内幸町1丁目2番2号

会社

明 細 書

1. 発明の名称

登光免疫测定法用容器

2. 特許請求の範囲

(1) 螢光を発する試料を保持する容器であって、 試料と接しない外側表面ないしは内層に、登光を 反射する層を形成させた事を特徴とする螢光免疫 測定法用容器。

(2) 優光を反射する層が、金属または金属を含有する物質よりなる事を特徴とする特許請求の範囲第1項記載の螢光免疫測定法用容器。

(3) 試料と接する面がプラスチックよりなる事を 特徴とする特許請求の範囲第 1 項記載の發光免疫 測定法用容器。

3. 発明の詳細な説明

〔産菜上の利用分野〕

本発明は免疫検査の一手法である螢光免疫測定法に用いられる試料容器に関するものである。 〔従来技術〕

螢光分析は極微量分析の一手法として広く利 用されているが、今日ではこの測定技術を応用し た免疫検査法である螢光免疫測定法が臨床検査に とり入れられつつある。との測定法は一般に酵素 免疫測定法と呼ばれている手法を発展させた髙成 度の免疫測定法で、これまで最も感度が高いとい われた放射免疫測定法を上まわる程の微量測定が 可能であるといわれている。この測定法は、容器 の内側表面に抗原(もしくは抗体)を吸着固定し、 次いで抗体(もしくは抗原)を加えて抗原一抗体 反応を順次行なわせ、最後に酵素を標識した抗体 (もしくは抗原)を反応させる。さらに、検体に 固定されたとの酵素に対して螢光基質(酵料によ る反応で盤光を発する物質)を加え、これに励起 光を照射し、試料が発する螢光量を読み取る、と いりものである。

後光免疫測定法に用いるための容器としては従来、特開昭 5 9 - 132335号公報が知られている。 これは容器を構成する材料自体が発する自己螢光 を抑えて、試料が発する螢光を精度よく検知しよ 一方、自己優光が小さく、実際の優光測定には 殆んど影響を与えない低優光材料も数多く、 を与えない低優光材料も数多及、 の表し、また測定機器の方も、励起液が可能を が表しても精度の高い対応が可能で、 がっクグラウンドとなる自己登光も自動的に補正 されるように改良されている。従って、 されるように低自己優光の容器を用いるととは ずしも必要とはされないが、試料の発する優光 効率よく、より多く捕集することができれば、微

螢光を反射する暦(2)は、金属ないし金属を含有する物質からなる。

本発明で用いることのできる金属としては、銀、水銀、金、白金、鰯、アルミニウム、ニッケル、ナず、チタン、クロム、インジウム等の他、水銀アマルガムや上配金属の合金であってもよく、また、金属を含む物質としては、金属の微粒子を樹

弱な螢光であっても一層感度の高い 測定が可能と なるのであり、そのような潜在的なニーズは多い。 本発明者らは、とのようなニーズに応えるため 種々の方法について検討を行ない、容器の内側に 向って螢光を反射する層を設けることによって測 定の感度を高め得ることを見出し、鋭意研究を進 めて本発明を完成させるに至ったものである。 〔発明の目的〕

即ち本発明の目的は、髙感度の測定を可能に する優光免疫測定法用容器を提供するにある。 〔発明の構成〕

本発明は、螢光を発する試料を保持する容器であって、試料と接しない外側表面ないしは内層に、螢光を反射する層を形成させた事を特徴とする螢光免投測定法用容器である。

容器の形状としては、マイクロプレート、キュベット、試験管、スピッツ、反応板などがあるが、 用途に応じて選ばれるものであり特に限定される ものではない。

螢光免疫測定法では、前述のとおり抗原、抗体

脂中に分散させた銀ペースト、金属ペイント等を挙げるととができる。プラスチック成形品(1) や成形容器(4) の表面に金属ないし金属を含む物質よりなる反射層(2) を形成する方法としては、金属のメッキ、蒸潜、スパッタリング、イオンプレーティング、また、金属を含む物質のコーティング等があるが、これらの方法に限定されるものではない。

反射層(2)の装面にプラスチック袋面層(3)を形成 する方法としては、プラスチックの溶液、エマル ジョン等をコーティング、あるいはその中に容器 をディッピングする方法の他、プラズマ重合等に よりプラスチック層で被覆する方法も用いりる。

プラスチック成形品(1) および プラスチック 決面 層(3) を形成する プラスチックとしては、自己を光の少い透明なものであればどのようなものでもよいが、たとえばポリスチレン、ポリなチルメタアクリレート などが好 強 で で の 安面が抗原、抗体等の 蛋 質 の 吸 類 性を 改善する ための 処理 が 加 え られ て 容 器 の だ な ない。また、本 発明 で は 容 器 の えない。また、本 発明 で は 容 器 の クラス

チック層を通して螢光を反射増幅させるため、と の層内での螢光損失を少くする意味で層厚は海い 方が好ましい。

また反射層(2)となる金属層の厚さは、反射機能 を保持しているならば特に限定されるものではな い。成形容器(4)を形成する材質としてはプラスチ ックの他、ガラス、セラミック、金属等も使用す ることができ、特に限定されない。プラスチック を使用する場合でも、上記のような自己優光性や 透明性の制約はなく、ポリエチレン、ポリプロピ レン等を含めて各種のプラスチックを使用すると とができる。また、金属を使用する場合は、その 内側表面を鏡面に仕上げることにより反射層(2)の 形成が不要になる利点がある。また、第2図にお ける反射層(2)を、銀ペースト、金属ペイント等を 用いて形成させた場合は、その表面は実質的に樹 脂層(プラスチック)からなっており、プラスチ ック 表面 層(3) の形成を省略することが可能である。 〔発明の効果〕

本発明の優光免疫測定法用容器を用いる事に

植 頻	S 社 Sタイプ	S 社 アミノ タイプ	A 社	B社	C社
公光 強度	1 1	6	1 4	8	5

ポリ塩化ビニール製マイクロプレート

種	類	D	社	E	社·	F	社	G :	社 イプ		社 イプ
登 光 強	度	8	0	6	0	2	4 0	1		1	3

<奥施例1>

プラスチック容器として住友ベークライト剱製エリザ用プレートアミノ化タイプ (ポリスチレン製、品番MS - 3696F) を用いて、これに螢光反射層を形成した。反射層としてはアルミニウムの砂膜を、日本真空工薬社製スパッタリング装置を

以下比較例、実施例をあげて本発明をより具体 '的に説明する。

〈谷考例1〉

盤光免疫測定法用容器として、各社のポリスチレンおよびポリ塩化ビニール製のマイクロプレートを用いて自己螢光の比較を行った。

歴光測定機は、ダイナテック社製マイクロフルオール(Micro FLUOR、商品名)を用いた。励起被長、螢光波長はそれぞれ365 nm、450 nmで測定を行った。この波長は代表的な螢光試薬4ーメチルウンベリフェロンの測定波長に相当する。結果は第1表に示した通りで、一部を除き、その大半が低自己螢光であることが分かる。

用いて 5 mAで1 2 0 分処理する事により、成形品の外側表面に形成した。

プレートの各ウエルに、 4 ーメチルウンベリフェロンの水溶液を 1 0⁻⁵ ~ 1 0⁻⁸ Mの濃度で100 ML加えた。 参考例 1 と同じ盤光剛定機を用い同様の 放長で盤光強度を測定した。 なお比較例として、 反射脂を形成していないプレートを用いて回様の 測定を行った。 第 2 袋に示したとおり、 本発明による容器を用いた場合整光強度が増大することが かる。

プレ-	MB 度 M	1 0-8	10-7	1 0-6	10-6
比較例	未処理プレート	5	4 5	5 2 0	1039
奥施例	反射層を形成 したプレート	18	2 3 8	1014	4 2 0 2

< 與施例 2 >

フロー社製マイクロプレート(ポリ塩化ビニール製、HAタイプ)を用いて、成形品の外側表面に銀メッキを行った。

とのプレートに、β-D-ガラクトンダーゼ(シグマ社製、以下β-Gal)を10⁻²~10⁻⁵ m// 回の優度で1004L/ウェル入れ、4℃で18時間的酸した。生理食塩水で洗浄した後、さらに3×10⁻⁴ Mの4-メチルウンペリフェリルーβ-D-ガラクトンド(コッホーライト社製)を50/ U/ウェル加え室温で30分間反応させた。グリン・水酸化ナトリウム緩衝像(PH103)を2004L/ウェル加定を行った。比較例として別定を行った。比較例として別定を行った。比較例として別定を行った。第3表に示したとおり、本発明の反射層の効果が大きいことが分かる。

	ß)	3	费			
プレ-	B-Ga ト	L强度 则 ml	10-6	10-4	10-3	1 0-2	1
突施例	銀メ	ッキレート	7 5	199	568	856	
比較例	未処す	里	3 2	6 2	154	271	

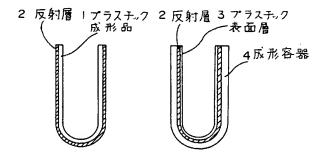
4. 図面の簡単な説明

第1 図および第2 図は、本発明の一実施例と 大る簡構成を説明するための図で、第1 図はプラ スチック成形品の外側表面に反射層を設けた容器、 第2 図は成形容器とその内側のプラスチック表面 脳との間(内間)に反射層を設けた容器である。

特許出願人

住友ペークライト株式会社

第 1 図 第 2 図



⑪特許出願公開

昭62-66141 ⑩ 公 開 特 許 公 報 (A)

(51) Int Cl.4

識別記号

广内整理番号

43公開 昭和62年(1987)3月25日

21/03 G 01 N 21/64 33/543 7458-2G 7458-2G

D - 7906 - 2G

審査請求 未請求 発明の数 1 (全4頁)

螢光免疫測定法用容器 🛭 発明の名称

> 创特 願 昭60-205391

昭60(1985)9月19日 22出

芳 明 辺 79発 明 者 渡

東京都千代田区内幸町1丁目2番2号 住友ベークライト

株式会社内

司 武 勿発 明 者 加

東京都千代田区内幸町1丁目2番2号 住友ベークライト

株式会社内

住友ベークライト株式 ①出 願 人

東京都千代田区内幸町1丁目2番2号

会社

朔

1. 発明の名称

簽 光 免 疫 測 定 法 用 容 器

2. 特許請求の範囲

(1) 螢光を発する試料を保持する容器であって、 試料と接しない外側表面ないしは内層に、登光を 反射する層を形成させた事を特徴とする螢光免疫 測定法用容器。

(2) 螢光を反射する層が、金属または金属を含有 する物質よりなる事を特徴とする特許請求の範囲 第1項記載の發光免疫測定法用容器。

(3) 試料と接する面がプラスチックよりなる事を 特徴とする特許請求の範囲第1項記載の發光免疫 测定法用容器。

3. 発明の詳細な説明

〔産菜上の利用分野〕

本発明は免疫検査の一手法である螢光免疫測 定法に用いられる試料容器に関するものである。 〔従来技術〕

螢光分析は極微盤分析の一手法として広く利 用されているが、今日ではとの測定技術を応用し た免疫検査法である螢光免疫測定法が臨床検査に とり入れられつつある。この御定法は一般に酵素 免疫測定法と呼ばれている手法を発展させた髙感 度の免疫測定法で、これまで最も感度が高いとい われた放射免疫測定法を上まわる程の微量測定が 可能であるといわれている。この測定法は、容器 の内側表面に抗原(もしくは抗体)を吸着固定し、 次いで抗体(もしくは抗原)を加えて抗原一抗体 反応を順次行なわせ、最後に酵素を標識した抗体 (もしくは抗原)を反応させる。さらに、検体に 固定されたとの酵素に対して螢光基質(酵素によ る反応で螢光を発する物質)を加え、これに励起 光を照射し、試料が発する螢光量を読み取る、と いりものである。

螢光免疫測定法に用いるための容器としては従 来、特開昭 5 9 - 132335 号公報が知られている。 これは容器を構成する材料自体が発する自己盤光 を抑えて、試料が発する螢光を精度よく検知しよ

螢光を反射する層 (2) は、 金属ない し金属を含有する物質からなる。

本発明で用いることのできる金額としては、銀、水銀、金、白金、銅、アルミニウム、ニッケル、ナブ、チタン、クロム、インジウム等の他、水銀アマルガムや上記金萬の合金であってもよく、また、金属を含む物質としては、金属の微粒子を樹

弱な優光であっても一層 & 度の高い 測定が可能となるのであり、そのような潜在的なニーズは多い。本発明者らは、とのようなニーズに応えるため 種々の方法について検討を行ない、容器の内側に向って優光を反射する層を設けることによって測定の & 度を高め得ることを見出し、鋭意研究を進めて本発明を完成させるに至ったものである。 (発明の目的)

即ち本発明の目的は、高感度の測定を可能に する優光免疫測定法用容器を提供するにある。 〔発明の構成〕

本発明は、後光を発する試料を保持する容器 であって、試料と接しない外側装面ないしは内層 に、後光を反射する層を形成させた事を特徴とす る後光免疫測定法用容器である。

容器の形状としては、マイクロプレート、キュベット、試験管、スピッツ、反応板などがあるが、 用途に応じて選ばれるものであり特に限定される ものではない。

盤光免疫測定法では、前述のとおり抗原、抗体

脂中に分散させた銀ペースト、金属ペイント等を挙げることができる。プラスチック成形品(1) や成形容器(4) の表面に金属ないし金属を含む物質よりなる反射層(2) を形成する方法としては、金属のメッキ、蒸潜、スペッタリング、イオンプレーティング、また、金属を含む物質のコーティング等があるが、これらの方法に限定されるものではない。

反射層(2)の 要面に プラスチック 要面層(3)を 形成 する方法としては、 プラスチック の 容液、 エマル ジョン 等を コーティング、 あるいは その 中に 容器 を ディッピング する 方法の 他、 プラズマ 重合 等に より プラスチック層 で 被 関する 方法 も用 い りる。

チック層を通して螢光を反射増幅させるため、と の層内での螢光損失を少くする意味で層厚は海い 方が好ましい。

また反射層(2)となる金属層の厚さは、反射機能 を保持しているならば特に限定されるものではな い。成形容器(4)を形成する材質としてはプラスチ ックの他、ガラス、セラミック、金属等も使用す ることができ、特に限定されない。プラスチック を使用する場合でも、上記のよりな自己螢光性や 透明性の制約はなく、ポリエチレン、ポリプロピ レン等を含めて各種のプラスチックを使用すると とができる。また、金属を使用する場合は、その 内側表面を鏡面に仕上げることにより反射層(2)の 形成が不要になる利点がある。また、第2図にお ける反射層(2)を、銀ペースト、金属ペイント等を 用いて形成させた場合は、その表面は実質的に樹 脂暦(プラスチック)からなっており、プラスチ ック段面層(3)の形成を省略することが可能である。 (発明の効果)

本発明の優光免疫測定法用容器を用いる事に

槌	類	S 社 Sタイプ	S 社 アミノ タイプ	A 社	B社	C社
金光	- 強度	1 1	6	1 4	8	5

ポリ塩化ピニール製マイクロプレート

植 類	D社	E社·	F社	G 社 Aタイプ	G 社 HA タイプ
登光強度	8 0	60	240	1	1 3

< 奥施例 1 >

プラスチック容器として住友ベークライト蝌製エリザ用プレートアミノ化タイプ(ポリスチレン製、品番MS-3696F)を用いて、これに螢光反射層を形成した。反射層としてはアルミニウムの砂膜を、日本真空工薬社製スパッタリング装置を

より、高感度の測定が可能である。即ち本発明による反射層が測定試料の発する優光を反射する事により、測定機の感ずる優光強度が増大する。これにより、従来強度が弱く正確な測定が行えなかった複微量域の測定も、高い精度で測定が可能となる。

以下比較例、実施例をあげて本発明をより具体 '的に説明する。

くお考例1>

螢光免疫測定法用容器として、各社のポリスチレンおよびポリ塩化ビニール製のマイクロプレートを用いて自己螢光の比較を行った。

歴光測定機は、ダイナテック社製マイクロフルオール(Micro FLUOR、商品名)を用いた。励起被長、螢光波長はそれぞれ365 nm、450 nmで測定を行った。との波長は代表的な螢光試薬4ーメチルウンベリフェロンの測定波長に相当する。結果は第1表に示した通りで、一部を除き、その大半が低自己螢光であることが分かる。

用いて 5 mAで120分処理する事により、成形品の外側表面に形成した。

プレートの各ウエルに、4ーメチルウンベリフェロンの水溶液を10⁻⁸~10⁻⁸ Mの濃度で100 ML加えた。参考例1と同じ盤光測定機を用い同様 の放長で盤光強度を測定した。なお比較例として、 反射層を形成していないプレートを用いて同様の 測定を行った。第2 数に示したとおり、本発明に よる容器を用いた場合盤光強度が増大することが 分かる。

プレ-	MB BK M	10-8	10-7	1 0 - 6	1 0 - 5
比較例	未処理プレート	5	4 5	5 2 0	1039
契施例	反射層を形成 したプレート	1 8	238	1014	4 2 0 2

< 與施例 2 >

.

フロー社製マイクロプレート(ポリ塩化ビニール製、HAタイプ)を用いて、成形品の外側表面に 銀メッキを行った。

このプレートに、 β - D - ガラクトンダーゼ(シグマ社製、以下β - Gal)を10⁻²~10⁻⁵ 内/ M の後度で100µl/ウエル入れ、4℃で18時間的 B した。生理食塩水で洗浄した後、さらに3×10⁻⁴ M の4-メチルウンペリフェリルーβ - D - ガラクトシド(コッホーライト社製)を50ル/ウェル加え S a の 分間 反応させた。 グリン・00µl/ウェル加えて 30分間 反応を P H 10.3)を 200 ル C フェルカ で で の M に で で が の か と し で が 分 が る に で が 分 かる。

	ß	餌	3	夬			
プレー	B-Ga	と強度	1 0 - 5	10-4	10-3	1 0 - 2	1
突施例	鋭メ: プレ	, 中 / - ト	7 5	199	5 6 8	856	
比較例	未処理	里 / - ト	3 2	6 2	154	271	

4. 図面の簡単な説明

特許出願人

住友ペークライト株式会社

第 1 図 第 2 図

